# ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-56123

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)3月11日

B 01 D 53/34

1 3 6 A B 1 3 0

6816-4D 8616-4D

134 В 6816-4D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

64発明の名称 ガス中の水銀及びNOxの除去方法

> 願 平1-190493 ②)特

22)出 願 平1(1989)7月25日

明 饱発 者 大 垣 陽 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

饱発 明 者 吉 井 裕 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

@発 明 沢 者 藤 能 成 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

@発 明 君 宮 常 晴 抽 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 日本鋼管株式会社

加出 願 日本鋼管株式会社  $\lambda$ 

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

倒代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

> 明 糾 害

1. 発明の名称

ガス中の水銀及びNOxの除去方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 次亜塩素酸塩を含有する洗浄液に、水銀及 びNOxを含有するガスを接触して、この洗浄液 に水銀及びNOxを吸収除去せしめる工程と、

ついで、上記ガスを塩素と反応可能な還元剤を 添加した洗浄液に接触させて、このガス中に含ま れる塩素を除去する工程とを具備した、

ガス中の水銀及びNOxの除去方法。

- (2) 水銀及びNOx を吸収除去せしめる工程は、 p H 2 ~ 6 に調整された第一の洗浄液に水銀及び NOxを含有するガスを接触せしめる工程と、第 一の洗浄液と接触した後の上記ガスをpH6~9 に調整された第二の洗浄液と接触せしめる工程と を具備している請求項1に記載のガス中の水銀及 びNOxの除去方法。
- (3) 水銀及びNOx を吸収除去せしめる工程で は、洗浄液と接触した後のガス中に含まれる塩米

の 濃度 が 1 0 0 ~ 1 0 0 0 ag C Q 2 / N m 3 とな るように、上記洗浄波に添加する次亜塩素酸塩の 添加量を制御している請求項1に記載のガス中の 水銀及びNOxの除去方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ガス、とくに都市ごみや産業廃棄物 等の焼却炉から発生する排ガス中に含まれる水銀 及びNOxを除去する方法に関する。

「従来の技術」

都市ごみや産業廃棄物等の焼却炉から発生する 排ガス中には、法規制の対象となっている塩化水 素(HCl)、亜硫酸(SOl)等の酸性有害ガ スが含まれている。このため、通常、排ガスは乾 式法、半乾式法、または湿式法によって処理され ている。しかしながら、この排ガス中には上記有 害ガスと共に、水銀、水銀化合物、及び窒素酸化 物(NOx)が含まれており、上記従来の酸性ガ ス除去方法では、これらを除去することは出来な かった。

本発明は、上記の従来技術の問題点を解決するためになされたもので、水銀およびNOx を含有する燃焼排ガスを、湿式洗浄法によって、次亚塩素酸を含む洗浄液で処理し、水銀とNOx を除去した後、処理ガス中に含まれる塩素を効果的に除

ぞれポンプ 22、42、62によって洗浄液が抜出され、 搭上部に設置したスプレー手段 23、43、63によっ て塔内に噴霧され、排ガスと接触する。また、夫々の洗浄液はガスを洗浄する。これを防止するために、 なのり、吸収効率が低下する。これを防止するために、一定の塩類濃度となるように、補給液が供給 を洗煙廃水貯槽 80に抜出すと共に、補給液が供給 される。また、各塔から抜出された洗浄液は、洗煙廃水貯槽 80で混合され、中和された後、程 で混合しないで別々に処理しても良い。

第一塔 20及び第二塔 40から抜出された洗浄液のp H は検出計 24、44で自動計測され、この値に基づいて第一塔及び第二塔の被溜の p H が所定の値となるように、苛性ソーダ供給ポンプ 25、45が制御される。

第一塔及び第二塔の洗浄液スプレーラインには 貯槽90からポンプ 81により次亜塩素酸塩(例えば NaC QO)が供給される。一方、第三塔の洗浄 液スプレーラインには、貯槽100 からポンプ 101 去する、排ガス中の水銀とNOxの除去方法を提供するものである。

### [課題を解決する手段]

本発明は、次型塩素酸塩を含有する洗浄液に、水銀及びNOxを含有するガスを接触して、この洗浄液に水銀及びNOxを吸収除去せしめる工程と、ついで、上記ガスを塩素と反応可能な還元剤を添加した洗浄液に接触させて、このガス中に含まれる塩素を除去する工程とを具備したガス中の水銀及びNOxの除去方法である。

# [実施例]

### 実 施 例 I

第1図は、本発明方法を実施するための3塔の選式ガス洗浄塔20、40、60を租合わせた除去装置を示す。各塔の構造は、特に限定されるものではないが、気液接触効率の良い、スプレー塔、若しくは充填塔構造をなすスプレー塔が望ましい。 俳ガスと洗浄液との接触は向流もしくは並流のいずれでもよいが、向流による方が効率が良い。各塔の下部には、液溜21、41、61が設けてあり、それ

により塩素と反応する還元剤(例えば、亜硫酸ソ ーダNa2SO1)が供給される。

第二塔及び第三塔スプレー手段43.63の上部にはデミスター46.66が設置されており、ガスに伴って飛散するミストを除去している。

本発明では、燃焼排ガスを電気集塵機10でダスト除去した後、上記湿式ガス洗浄塔の第一塔20項部に導く。この燃焼排ガスは、300℃程度であり、この中には塩化水素(HCQ)や硫黄酸化物(NOx)や水銀(Hg)が含まれている。第一塔20に導入されたN上記排ガスは、スプレー手段23から噴霧されたNL記排ガスは、スプレー手段23から噴霧されたNL記排ガスは、スプレー手段23から噴霧されたNLので、洗浄液中のNaCQОの一部は、上記ガスに同伴するHCQの大のように進行する。NaCQO+HCQのHCQの

この反応は、pHが7以下で急激に進行する。上記酸分解によって生成したCQ2は、排ガス中の

NOx と次のように反応し、洗浄液中に吸収されると考えられる。

2 N O + C & 2 = 2 N O C &

2 N O C & + H 2 O = 2 H N O 2 + 2 H C &

第2図は、縦軸にNOx除去率、横軸に洗浄液pH値をとり、NaCIOを同量添加し、更にNaOHでpH調節した時の、洗浄液のpHとNOx除去率との関係を示す。この図は、60%以上のNOx除去率を達成するために、洗浄液のpHを約6以下とする必要があることを示している。従って、第一塔での洗浄液のpHは2~6となるように制御してNOxの酸化をおこない、洗浄液中に吸収させることが望ましい。

一方、排ガス中の水銀の形態は、その大部分が 水溶性の第二水銀(Hg<sup>++</sup>)であるが、一部不溶 性の金属水銀(Hg<sup>o</sup>)が含まれており、加えら れたNaCQOによって、第二水銀に酸化された 洗浄液中に吸収される。

H g + N a C Q O = H g O + N a C Q H g O + 2 H C Q = H g C Q 2 + H 2 O

揮散し、排ガス中に戻り、水銀除去率が低下する
ためである。生成したCQ2ガスは、第一塔20と第二塔40だけでは消費されず、第三塔60に導入とは、装置材質上好ましくない。従って、第三塔60においてCQ2と反応するCQ2を除去することが必要である。この選元剤の添加量は、第三塔60に等要である。この選元剤の表別量は、第三塔60に等要である。この選元剤の表別量は、第三塔60に等更である処理ガス中に含まれるCQ2に対して等量以上あればよい。又、洗浄液のORP(酸化湿元 は、遠元剤の添加量を制御してもよい。

第1 図に示す装置を使用して、本発明方法を実施した。すなわち、ごみ焼却工場の電気集塵機出口の煙道より、燃焼排ガスを分岐し、三塔で構成された洗浄装置に遅いた。NaC贝Oの供給は、第一塔20のみとし、NaOHによって、第一塔20及び第二塔40の洗浄液のpHをそれぞれ4.0、7.5となるように制御した。さらに第三塔60には、違元剤としてNazSOョ水溶液を加えた。

第3図は、洗浄液のpHと水銀除去率との関係を示す。この図は、高効率で水銀除去するためには、洗浄液のpHは、約6~9とする必要があることを示している。従って、水銀除去に関して、第一塔20である程度の水銀を洗浄液中に吸収除去した後、第二塔40における洗浄液のpHを約6~9に制御して、水銀の吸収除去をおこなうことが望ましい。

第二塔 40において、NaClOを供給することは、水銀およびNOxに対して、除去率を向上させる効果がある。しかし、排ガスの燃焼状態や、水銀とNOxの濃度によっては、第一塔 20で供給したNaClOを供給する必要ははで十分な場合があり、はないし、また、第二塔出口には、デミスター 46を設置し、排ガスに同伴するミストを除去することが、ないまた、第三塔に近要である。何故なら、後述するように、第三塔 10から排出されたミスト中に含まれる水銀が混元され、金属水銀が混元され、金属水銀が混元され、金属水銀が混元され、金属水銀が混元され、金属水銀が高に対して、第二塔 40から排出されたミスト 再

第4図は第一塔20でのNaClOの添加量を変化させたときの、第二塔40での処理ガス中の塩溶液度と第三塔60での処理ガスの原ガスに対する水銀及びNOxの除去率を示す。この図から、水銀除去に関しては、第二塔処理ガス中のClow旋度を20g/Nm³以上とすることにより、約90%以上の水銀除去ができた。一方、NOxに対しては、400g/Nm³とすることにより、80%以上のNOxを除去できた。

また、第二塔処理ガス中の C Q 2 に対する、供給した N a 2 S O 4 のモル比と第三塔処理ガス中の C Q 2 を第5 図に示す。その結果、モル比が 1 . O 以上で、第三塔の処理ガス中の C Q 2 濃度が 2 O m / N m 3 以下となった。この図から、等モル以上の添加が好適であることがわかる。

以上の結果から、上記実施例では、燃焼排ガス中の水銀及びNOxが高効率で除去できると共に、洗浄塔より排出する塩素濃度を著しく低減できることがわかる。

# 実施例Ⅱ

上記実施例では、三塔構造の水銀及びNOx除 去装置について述べたが、本発明方法は、構造の 異なる他の装置を用いても実施できる。例えば、 第6図は一塔200 からなる除去装置を示す。この 装置は、塔の下部に液溜201 を、またこの液溜20 1 に連通した貯槽202 が設けてあり、洗浄液が抜 出され、搭下段又は搭中段に設置したスプレー手 段 203, 204によって塔下部または塔内の洗浄部 20 5 上に噴霧され、排ガスと接触する。抜出された 洗浄液の p H は検出計 208. 287で自動計測され、 この検出値に基づいて貯槽 202 又は液溜 201 の pli が所定の値となるように、 H C g 供給ポンプ 208 又は209 苛性ソーダ供給ポンプ209 が制御される。 各洗浄液スプレーラインには次重塩素酸塩(例え ば N a C 1 O ) が供給される。一方、貯槽 210 、 冷却塔211、及び塔上段のスプレー手段212、及 びその下部にある集被部213を備えた洗浄液スプ レーラインには、塩米と反応する還元剤(例えば、 亚硫酸ソーダNa₂SO。)が供給される。上記

NaClOの一部は、上記ガスに同伴するHClによって、酸分解を受け、塩紫ガスを発生する。上記酸分解によって生成したClzは、排ガス中のNOxと反応し、洗浄液中に吸収される。一方、排ガス中の水銀の形態は、その大部分が水溶性の第二水銀(Hg゚)であるが、一部不溶性の金属水銀(Hg°)が含まれており、加えられたNaClOによって、第二水銀に酸化された洗浄液中に吸収される。この処理後の排ガスは、塔中

段に上昇し、ここでも同様にスプレー手段204 か

ら噴霧された洗浄液により、NOxと水銀が吸収

除去される。これらの処理で生成したCaョガス

は、塔下段と塔中段だけでは消費されず、塔上段

に導入される。塔上段において、Claと反応す

スプレー手段204, 212の上部にはデミスター214.

215が設置されており、ガスに伴って飛散するミ

この装置を用いて本発明方法を実施するには、

燃焼排ガスを予冷部216 から導入し、NaCQO

を含む洗浄液で冷却する。この時、洗浄液中の

ストを除去している。

る週元剤を添加し、残存する C ℓ 2 を除去する。 実施例Ⅲ

第7図は、二塔300.301からなる除去装置を示 す。この装置は各塔の下部に液溜302,303が設け であり、洗浄液が抜出され、各搭内部に設置した スプレー手段304、305によって各塔内の洗浄部 306,307上に喷霧され、排ガスと接触する。抜出 された洗浄液の p H は夫々検出計 308. 309で自動 計測され、この値に基づいて液溜のpHが所定の 値となるように、 苛性ソーダ供給ポンプ310, 311 が制御される。各洗浄液スプレーラインには次亜 塩素酸塩(例えばNaCPO)が供給される。— 方、貯槽312、塔上段のスプレー手段313、及び その下部にある集波部314を備えた洗浄液スプレ ーラインには、塩素と反応する還元剤(例えば、 亜硫酸ソーダNa2SO3)が供給される。上記 スプレー手段305, 313の上部にはデミスター315. 316が設置されており、ガスに伴って飛散するミ ストを除去している。

この装置を用いて本発明方法を実施するには、

燃焼排ガスを第一の塔300 の頂部から導入し、 NaCIOを含む洗浄液で冷却する。この時、洗 浄波中のNaC ¶ Oの一部は、上記ガスに同伴す るHCIによって、酸分解を受け、塩素ガスを発 生する。上記酸分解によって生成したCQ2は、 排ガス中のNOxと反応し、洗浄被中に吸収され る。一方、排ガス中の水銀の形態は、その大部分 が水溶性の第二水銀 (Hg \*\*) であるが、一部不 溶性の金属水銀(Hg<sup>o</sup>)が含まれており、加え られたNaClOによって、第二水銀に酸化され た洗浄液中に吸収される。さらに第一の塔300で 処理された燃焼排ガス中のNOx及び水銀を第二 の塔301 の下段に導入し、ここで上記と同様にN 0 x 及び水銀の吸収処理をおこなう。これらの処 理で生成した C Q 2 ガスは、第一の塔 300 及び第 二の塔301 の下段だけでは消費されず、第二の塔 301 の上段に導入される。塔上段において、 Claと反応する選元剤を添加し、残存するCl 2 を除去する。

## 実施例IV

第8図は、二塔400,401からなる除去装置を示 す。この装置は第一の塔400 の下部に液溜402 が 設けてあり、この波溜402 に連通して貯槽403 が 設けてあり、洗浄液が抜出され、塔下部及び搭上 部に設置したスプレー手段404,405によって塔内 に噴霧され、排ガスと接触する。貯槽403 及び液 溜402 から抜出された洗浄液の p H は、 p H 検出 計 406, 407により自動計測され、この値に基づい て貯槽 403 又は液溜 402 の p H が 所 定 の 値 と な る ように、HC』供給ポンプ408 又は苛性ソーダ供 給ポンプ409 が制御される。各洗浄液スプレーラ インには貯槽410から次亜塩素酸塩(たとえば、 N a C Q O ) が供給される。一方、第二の塔 401 は、下部に液溜411を設け、洗浄液が抜出され、 スプレー手段412 によって塔内に噴霧され、排ガ スと接触する。この洗浄液スプレーラインには、 塩素と反応する遺元剤(例えば、亜硫酸ソーダ NazSO,)が供給される。上記スプレー手段 405, 412の上部にはデミスター413, 414が設置さ

るには、燃焼排ガスを第一の塔下部から導入し、 NaClOを含む洗浄液で冷却する。この時、洗 浄液中のNaCIOの一部は、上記ガスに同伴す るHC』によって、酸分解を受け、塩素ガスを発 生する。上記酸分解によって生成したCQ2は、 排ガス中のNOxと反応し、洗浄液中に吸収され る。一方、排ガス中の水銀の形態は、その大部分 が水溶性の第二水銀 (Hg \*\*) であるが、一部不 溶性の金属水銀 (Hg<sup>o</sup>) が含まれており、加え られたNaCIOによって、第二水銀に酸化され た洗浄波中に吸収される。さらに第一の塔下部で 処理された燃焼排ガス中のNOx及び水銀を第一 の塔の上段で吸収処理する。これらの処理で生成 したCQ₂ガスは、第一の塔だけでは消費されず、 第二の塔に導入される。第二の塔において、 Claと反応する還元剤を添加し、残存する Claを除去する。なお上記第6図乃至第8図を 用いた本発明方法の実施の説明では、各液溜、貯

れており、ガスに伴って飛散するミストを除去し

ている。

この装置を用いて本発明方法を実施す

他内の洗浄液の p H 値の制御、遠元剤の添加量の制御についてとくに記載しなかったが、第 1 図の装置を用いた本発明方法の実施について説明したのと同様の制御を行う。

#### [発明の効果]

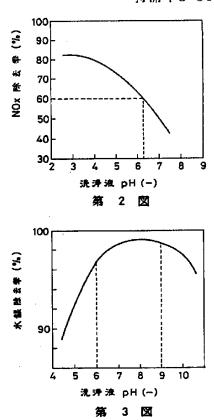
以上説明したように、本発明によれば、燃焼排 ガスなどのガス中に含まれるNOx及び水銀を確 実に除去すると共に、処理ガスに含まれる塩素を 吸収して大気中に放出することを阻止し、環境汚 染を防止することができる顕著な効果を発揮する。 4. 図面の簡単な説明

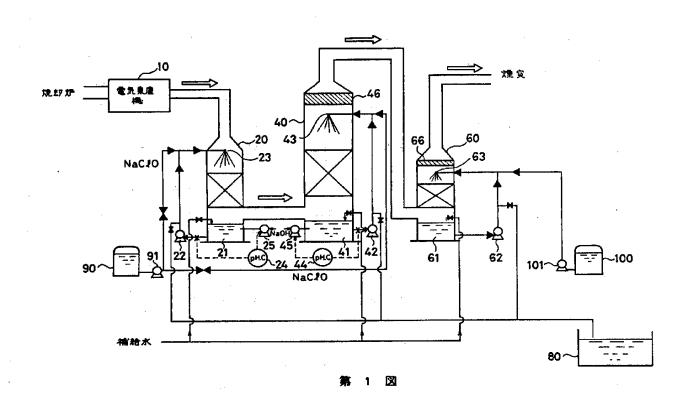
第1図は、本発明方法を実施する装置の一例を示す線図、第2図は洗浄液のpHとNOx除去率との関係を示す図、第3図は洗浄液のpHと水級除去率との関係を示す図、第4図は第一塔でのNaCとの関係を示す図、第4図は第一塔でのNaCとが三塔処理ガス中のCと2に対する、供給したNa2SO4のモル比と第三塔処理ガス中のC

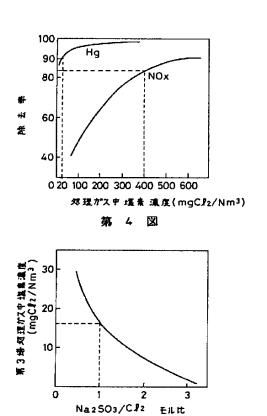
法を実施する装置の他の例を示す線図である。 10… 電気集題機、20… 第一塔、21… 液溜、22… ポ ンプ、23… スプレー手段、24… 検出計、25… 苛性 ソーダ供給ポンプ、40…第二塔、41…液溜、42… ポンプ、43…スプレー手段、44… 検出計、45… 苛 性ソーダ供給ポンプ、46… デミスター、60… 第三 塔、61…被溜、62…ポンプ、63…スプレー手段、 66… デミスター、80… 洗煙 魔水 貯槽、90… 貯槽、 91…ポンプ、 100… 貯槽、 101…ポンプ、 200 … 塔、201 … 液溜、202 … 貯槽、203,204 … スプレー手段、205 … 洗浄部、206,207 … 検出計、 208 … 塩酸供給ポンプ、209 … 苛性ソーダ供給ポ ンプ、210 … 貯積、211 … 冷却塔、212 … スプレ - 手段、 213 … 集被部、 214.215… デミスター、 216 … 予冷部、 300 …第一の塔、301 …第二の塔、302. 303…液

300 … 第一の塔、301 … 第二の塔、302、303… 液 溜、304、305… スプレー手段、306、307… 洗浄部、 308、309… 検出計、310、311… 苛性ソーダ供給ポ ンプ、312 … 貯槽、313 … スプレー手段、314 … 集液部、315.316…デミスター、
400 …第一の塔、401 …第二の塔、402 …液溶、
403 … 貯槽、404.405…スプレー手段、406,407
… 検出計、408 …塩酸供給ポンプ、409 … 苛性ソーダ供給ポンプ、411 …液溜、412 …スプレー手段、413.414…デミスター、

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

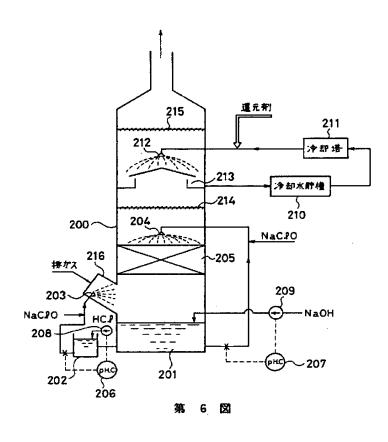


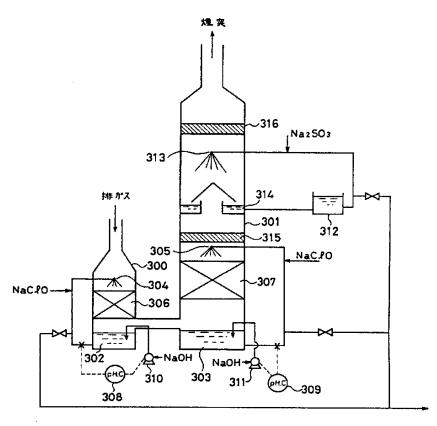




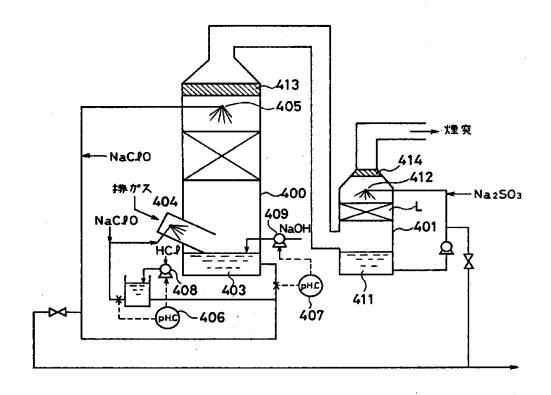
(第2塔)

5 🕱





第 7 図



第 8 図